

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 5 月 8 日(08.05.2014)

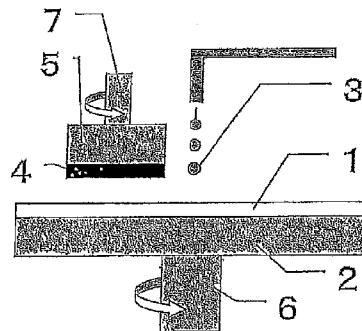


(10) 国際公開番号
WO 2014/069042 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/24 (2012.01) *C08G 18/65* (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/067325
- (22) 国際出願日: 2013 年 6 月 25 日(25.06.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-240425 2012 年 10 月 31 日(31.10.2012) JP
- (71) 出願人: 東洋ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 中井 良之(NAKAI, Yoshiyuki); 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3 - 9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLISHING PAD AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 研磨パッド及びその製造方法



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a polishing pad which exhibits high water absorption and is still capable of maintaining high dimensional stability upon absorption of moisture or water, and which does not easily cause scratches on a surface to be polished of an object to be polished; and a method for producing the polishing pad. A polishing pad which has a polishing layer that is formed of a polyurethane foam having fine cells, and which is characterized in that: the polyurethane foam contains (1) an isocyanate-terminated prepolymer (A) that is obtained by reacting a prepolymer starting material composition (A') which contains an isocyanate monomer, a high molecular weight polyol (a) and a low molecular weight polyol, (2) an isocyanate-terminated prepolymer (B) that is obtained by reacting a prepolymer starting material composition (B') which contains a polymerized diisocyanate and a high molecular weight polyol (b), and (3) a reaction hardened product of a polyurethane starting material composition which contains a chain extender; and the polymerized diisocyanate contains pentamers or higher oligomers in an amount of 40% by weight or less.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2014/069042 A1



本発明は、高吸水性でありながら吸湿又は吸水時に寸法安定性を高く維持することができ、かつ研磨対象物の被研磨面にスクラッチを生じさせ難い研磨パッド及びその製造方法を提供することを目的とする。微細気泡を有するポリウレタン発泡体からなる研磨層を有する研磨パッドにおいて、前記ポリウレタン発泡体は、(1) イソシアネート単量体、高分子量ポリオールa、及び低分子量ポリオールを含有するプレポリマー原料組成物A'を反応させて得られるイソシアネート末端プレポリマーA、(2) 多量化ジイソシアネート、及び高分子量ポリオールbを含有するプレポリマー原料組成物B'を反応させて得られるイソシアネート末端プレポリマーB、及び(3) 鎖延長剤を含有するポリウレタン原料組成物の反応硬化体を含み、前記多量化ジイソシアネートは、5量体以上の成分を40重量%以下の割合で含有することを特徴とする研磨パッド。